

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局

(43) 国際公開日  
2019年3月28日(28.03.2019)



(10) 国際公開番号

**WO 2019/058819 A1**

- (51) 国際特許分類:  
*C23C 14/34* (2006.01) *G11B 5/851* (2006.01)  
*C23C 14/06* (2006.01) *H01F 41/18* (2006.01)  
*G11B 5/64* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2018/030435
- (22) 国際出願日: 2018年8月16日(16.08.2018)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願 2017-180829 2017年9月21日(21.09.2017) JP
- (71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP];  
〒1008164 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 清水正義 (SHIMIZU, Masayoshi);  
〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).  
岩淵靖幸 (IWABUCHI, Yasuyuki); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).  
増田愛美 (MASUDA, Manami); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X金属株式会社磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: アクシス国際特許業務法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号 新橋アイマークビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))



WO 2019/058819 A1

(54) Title: SPUTTERING TARGET, METHOD FOR PRODUCING LAMINATED FILM, LAMINATED FILM, AND MAGNETIC RECORDING MEDIUM

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット、積層膜の製造方法、積層膜および、磁気記録媒体

(57) Abstract: This sputtering target contains Co and Pt as metal components, and the molar ratio of the Pt content to the Co content is 5/100 to 45/100. The sputtering target also contains Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> as a metal oxide component.

(57) 要約: この発明のスパッタリングターゲットは、金属成分としてCo及びPtを含有し、Coの含有量に対するPtの含有量のモル比が5/100~45/100であり、金属酸化物成分としてNb<sub>2</sub>O<sub>5</sub>を含有してなるものである。